（二）　三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五五〇メガヘルツを超えるもの

（三）　三七ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、二・二ギガヘルツを超えるもの

ヘ　最大出力周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの

十四～十六の二　［略］

十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品

イ～ト　［略］

チ　位相シフト膜を有する多層マスクであって、光源の波長が二四五ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるために設計したもの（トに該当するもの及び第一号から第八号の四までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。）

リ・ヌ　［略］

十七の二　マスクの製造に用いられる基材であって、モリブデン及びシリコンからなる多層膜の反射構造を有するマスクブランクのうち、次のイ及びロに該当するもの

イ・ロ　［略］

十八～二十三　［略］

二十四　前二号のいずれかに該当する基板であって、当該基板の上に炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムのエピタキシャル層を少なくとも一層以上有するもの（第十八号に該当するものを除く。）

第七条　［略］

第八条　輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一　伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ　［略］

ロ　ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの（人工衛星に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。）

ハ　［略］

ニ　一二四度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの（人工衛星に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。）

二～八の二　［略］

［新設］

十四～十六の二　［略］

十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品

イ～ト　［略］

チ　位相シフト膜を有する多層マスクであって、次のいずれかに該当するもの（トに該当するもの及び第一号から第八号の四までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。）

（一）　複屈折率が七ナノメートル毎センチメートル未満のガラスを用いたマスク基板材料から製造されたもの

（二）　光源の波長が二四五ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるために設計したもの

リ・ヌ　［略］

十七の二　マスクの製造に用いられる基材であって、モリブデン及びシリコンからなる多層膜の反射構造を有するマスクブランクのうち、次の（一）及び（二）に該当するもの

（一）・（二）　［略］

十八～二十三　［略］

二十四　前二号に該当する基板であって、当該基板の上に炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムのエピタキシャル層を少なくとも一層以上有するもの（第十八号に該当するものを除く。）

第七条　［略］

第八条　輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一　伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ　［略］

ロ　ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの（人工衛星に搭載するように設計したものを除く。）

ハ　［略］

ニ　一二四度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの（人工衛星に搭載するように設計し、改造したものを除く。）

二～八の二　［略］